



## 第41回光学薄膜研究会開催のご案内

拝啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また平素は本研究会活動に対し格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本研究会では、新型コロナウイルスの取り巻く環境より、対応を再度慎重に検討した結果、2021年度 第4回 光学薄膜研究会は、**機械振興会館でのリアル講演は取りやめとし、Web配信のみの開催に変更させていただきます。**

- ◆日時 : 2022年1月28日 (金)
- ◆場所 : 機械振興会館 (〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 )  
もしくは Microsoft teams を利用した Web  
お申込者全員に事務局の山口氏より参加招待メールを  
1月25日にお送り致します。招待メールが届かなかった  
場合お手数ですが、[naotaka.yamaguchi@merckgroup.com](mailto:naotaka.yamaguchi@merckgroup.com)  
までお問い合わせ願います。

### 1. 光学薄膜研究会 研究会

- 研究会 : 13:00~15:50
- 定員 : 250名 (先着順)
- 参加費 : 【会 員】 無料 (法人会員、個人会員)  
但し、法人会員 3名/口まで

---

### 2. 【研究会プログラム】

- 2.1 代表挨拶 東海大学 室谷教授 (13:00-13:05)
- 2.2 『ALD (原子層堆積) 原理と光学分野への応用』 (13:05-13:50)  
PICOSUN JAPAN 株式会社 セールスマネージャー 八尋 大輔 氏  
ALD は近年、半導体をはじめとする幅広い分野での利用が拡大している技術である。膜質が緻密でバリア性が高く、複雑形状への付き回り性の良さや低温成膜が可能なることから注目されているが、特性上の限界もある。  
本講演では ALD サイクルを細かく解説し、原理的な制約と可能性について述べ、また特に光学分野にフォーカスしたアプリケーションを紹介する。
- 2.3 『最小偏角法による赤外屈折率測定装置の紹介』 (13:50-14:35)  
分光計器株式会社 営業部 東日本営業所 川端 宏信 氏  
最小偏角法による赤外屈折率測定装置を開発しました。屈折率を求めるための頂

角、最小偏角の測定方法やサンプル測定事例などを中心にご紹介をさせていただきます。

=====休憩===== (14:35-14:50)

2.4 『OIC 設計コンテストの説明』 (14:50-15:10)

セイコーエプソン株式会社 ビジュアルプロダクツ事業部 矢野 邦彦 氏  
2022年OIC設計コンテストに関して、出題問題、評価ポイント、申込方法など  
をご紹介します。

2.5 『会員企業による会社紹介』 (15:10-15:40)

中日クラフト株式会社  
JFE テクノリサーチ株式会社  
HEF DURFERRIT JAPAN 株式会社

2.6 事務局からのご案内 (15:40-15:50)

**\*注：プログラムは、諸般の事情により変更する場合がございます。**

---

3. 参加申込：光学薄膜研究会 事務局 斉藤 ( [info-otfse@otfse.org](mailto:info-otfse@otfse.org) ) 宛  
メールにて

- ① 氏名, 会社名, 部署 :
- ② メールアドレス :

をご連絡ください。申し込み締め切り1月24日(月)です。

**※出来るだけ早いお申込にご協力戴けますと助かります。**

以下、ご注意とお願いです。

- ・申込は①～②すべてにご記載をお願いします。未記載がありますと確認連絡が必要となりますので、お手数ですが、事務局の負担軽減にご協力お願いいたします。  
代表者がお申込の場合も全員分のご記載をお願いします。
- ・講演資料は、1月24日頃にHP会員ページにアップします。

以上